

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 6 月 16 日 (16.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/054913 A1

(51) 国際特許分類: G02B 5/32, G03H 1/02

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017169

(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 18 日 (18.11.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-404999 2003 年 12 月 3 日 (03.12.2003) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): TDK
株式会社 (TDK CORPORATION) [JP/JP]; 〒1038272
東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

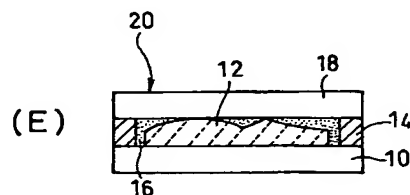
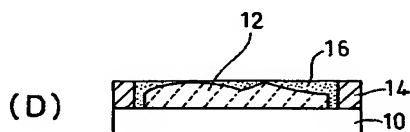
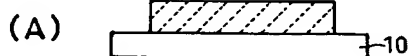
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 水島 哲郎

(MIZUSHIMA, Tetsuro) [JP/JP]; 〒1038272 東京都
中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 TDK 株式会
社内 Tokyo (JP). 三浦 栄明 (MIURA, Hideaki) [JP/JP];
〒1038272 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号
TDK 株式会社内 Tokyo (JP). 塚越 拓哉 (TSUK-
AGOSHI, Takuya) [JP/JP]; 〒1038272 東京都中央区日
本橋一丁目 1 3 番 1 号 TDK 株式会社内 Tokyo (JP).
吉成 次郎 (YOSHINARI, Jiro) [JP/JP]; 〒1038272 東
京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 TDK 株式会
社内 Tokyo (JP).(74) 代理人: 松山 圭佑, 外(MATSUYAMA, Keisuke et al.);
〒1510053 東京都渋谷区代々木二丁目 1 0 番 1 2 号
南新宿ビル Tokyo (JP).(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

/続葉有/

(54) Title: OPTICAL PARTS, OPTICAL RECORDING MEDIUM AND METHOD FOR MANUFACTURE THEREOF

(54) 発明の名称: 光学部品、光記録媒体及びその製造方法



(57) Abstract: A method for manufacturing an optical recording medium (20) which comprises providing an organic-inorganic hybrid material layer (12) on a substrate (10) by application and drying, covering the hybrid material layer with an organic silicon resin (16), and then laminating a light-transmitting substrate (18) on said organic silicon resin (16), wherein the hybrid material layer (12) and the organic silicon resin (16) are so selected as to have a little difference in refractive index and thus to be optically continuous and conform with each other, thereby resolving the effect of the unevenness in the thickness of the hybrid material layer (12). When an optical material layer such as an organic-inorganic hybrid material or the like is used as an optical part or an optical recording medium, the above method can be employed for resolving the adverse effect of the unevenness in the thickness of the layer caused in a drying step.

(57) 要約: 光学部品や光記録媒体として、有機-無機ハイブリット材料等の光学材料層を用いる場合に、その乾燥による厚みムラの影響を解消する。光記録媒体 20 は、基板 10 上に、有機-無機ハイブリット材料層 12 を塗布、乾燥して設け、これを、有機珪素樹脂 16 によって被い、更に該有機珪素樹脂 16 に光透過性基板 18 を積層することによって構成され、ハイブリット材料層 12 と有機珪素樹脂 16 との屈折率の差を小さくして、光学的に連続一体とすることにより、ハイブリット材料層 12 の厚みムラの影響を解消する。



ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。